

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成20年8月21日(2008.8.21)

【公表番号】特表2008-506730(P2008-506730A)

【公表日】平成20年3月6日(2008.3.6)

【年通号数】公開・登録公報2008-009

【出願番号】特願2007-521836(P2007-521836)

【國際特許分類】

A	0	1	N	25/32	(2006.01)
A	0	1	P	13/00	(2006.01)
A	0	1	N	37/34	(2006.01)
A	0	1	N	47/30	(2006.01)
A	0	1	N	47/36	(2006.01)
A	0	1	N	43/56	(2006.01)
A	0	1	N	43/80	(2006.01)

(F T)

A	0	1	N	25/32			
A	0	1	P	13/00			
A	0	1	N	37/34	1	0	6
A	0	1	N	47/30			B
A	0	1	N	47/36	1	0	1
A	0	1	N	43/56			D
A	0	1	N	43/80	1	0	1

【手續補正書】

【提出日】平成20年6月27日(2008.6.27)

【手續補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0030

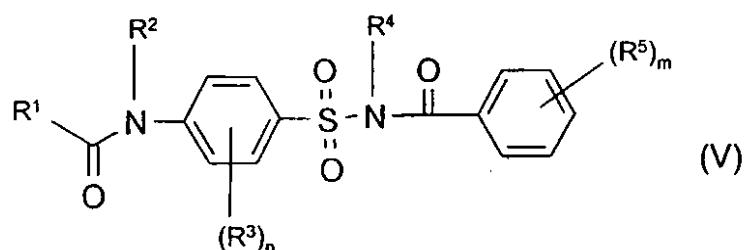
【補正方法】変更

【補正の内容】

[0 0 3 0]

(B 1 6) W O - A - 9 7 / 4 5 0 1 6 に記載されるような、式 (V) の N' - アシリ - N - ベンゾイル - アミノベンゼンスルホンアミド及びそれらの塩：

【化 6】



[式中、

R¹は、水素、炭化水素ラジカル、炭化水素-オキシラジカル、炭化水素-チオラジカル又はヘテロシクリルラジカル（好ましくは炭素原子を介して結合している）であり、ここで最後に言及した4種のラジカルの各々は、非置換であるか又はハロゲン、シアノ、二トロ、アミノ、ヒドロキシリ、カルボキシリ、ホルミル、カルボキサミド、スルホニアミド及び式Z^a-R^aのラジカルからなる群より選択される1つ又はそれ以上の同一か若しく

は異なるラジカルで置換され、

ここで各炭化水素部分構造は、好ましくは1～20個の炭素原子を有し、そして炭素含有ラジカルR¹(置換基を含めて)は、好ましくは1～30個の炭素原子を有し、

R²は、水素若しくは(C₁-C₄) - アルキルであり、好ましくは水素であるか、又は

R¹及びR²は、式-CO-N-の基と共に、3～8員の飽和若しくは不飽和の環のラジカルであり、

R³は、同一か又は異なり、そしてハロゲン、シアノ、ニトロ、アミノ、ヒドロキシル、カルボキシル、ホルミル、CONH₂、SO₂NH₂又は式Z^b-R^bのラジカルであり、

R⁴は、水素又は(C₁-C₄) - アルキル、好ましくは水素であり、

R⁵は、同一か又は異なり、そしてハロゲン、シアノ、ニトロ、アミノ、ヒドロキシル、カルボキシル、CHO、CONH₂、SO₂NH₂又は式Z^c-R^cのラジカルであり、